研究基盤技術センター 評価部

分光エリプソメータ 説明会のお知らせ

皆様におかれましては、日ごろより研究基盤技術センターの運営に ご協力いただきありがとうございます。

この度、下記の日程で分光エリプソメータ (ELPS)の使用方法の説明会を開催することとなりました。 参加を希望される場合は研究室ごとにお取りまとめの上、下記の様式にて返信をお願い致します。 (申込締切 平成23年2月10日 (木))

測定を希望されるサンプルがありましたら、当日お持ち下さい。

なお、人数に限りがありますので、研究室あたりの参加人数を 制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

記

日時: 平成23年2月16日(水) 9:30~17:00 場所: 通研 PCR (クリーンルーム) 第四実験室

> 申込締切:平成23年2月10日(木) 連絡先 : eac@riec.tohoku.ac.jp

装置概要:分光エリプソメータ

測定波長 250~800nm

最大試料サイズ Φ100mm × 2mm

エリプソパラメータ測定、光学定数解析、

膜厚解析(最大5層)

分光エリプソメータ(ELPS)説明会参加希望

所属:

参加人数: 連絡先:

測定を希望するサンプルの有無: